



Desk-top type UV irradiation system

卓上型UV照射装置

型式：MUV1000 オゾンレス型

型式：MUV2000 オゾン型

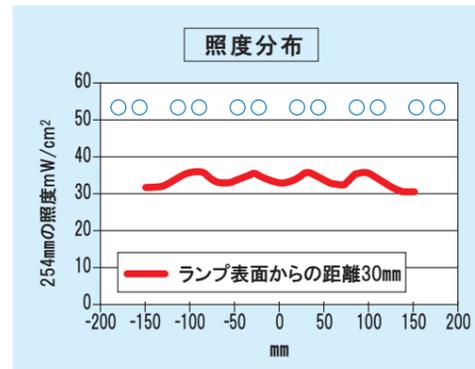


大型基板の処理が可能 試料にダメージを与えず高度な洗浄

MUV1000/2000は表面処理技術の一つであるUV処理用の卓上型UV照射装置です。卓上型ながら大型基板の処理が出来、表面改質やウエハ洗浄等の処理プロセスの開発に最適です。基板設置台の高さ調整が可能で、厚みのある試料にも対応出来ます。紫外線の照射エネルギーと二次的に発生するオゾンにより有機汚染物質を酸化分解し、試料の洗浄・改質を行います。ウェット洗浄とは異なり廃液を出さず、試料に物理的ダメージを与える事なく高度な洗浄効果が得られます。また、有機汚染物質はガス化して排気される為、有機汚染物質の再付着が起りません。

本装置は卓上型の紫外線(UV)照射装置で以下の機能を有しています。

- 最大φ300mmのシリコンウエハ、ガラスなどの基板(試料)にUV照射を行い、表面の有機物を除去し、濡れ性を向上させることが出来ます。
- 基板(試料)ホルダーの上下、または取替えが容易なため、厚みのある基板(試料)を処理することが可能となります。
- オゾン発生型装置は、オゾンによる処理を併用することにより、高いクリーニング効果が可能となります。
- 基板(試料)セット後の処理は自動運転が可能です。



卓上型UV照射装置(オゾンレス型)

MUV1000



■ MUV1000(オゾンレス型)仕様

型式	オゾンレス型 MUV1000
低圧水銀ランプ	オゾンレスランプ (U字型36W×6本)
波長[nm]	254
ランプ安定器	ラピッドスタート式

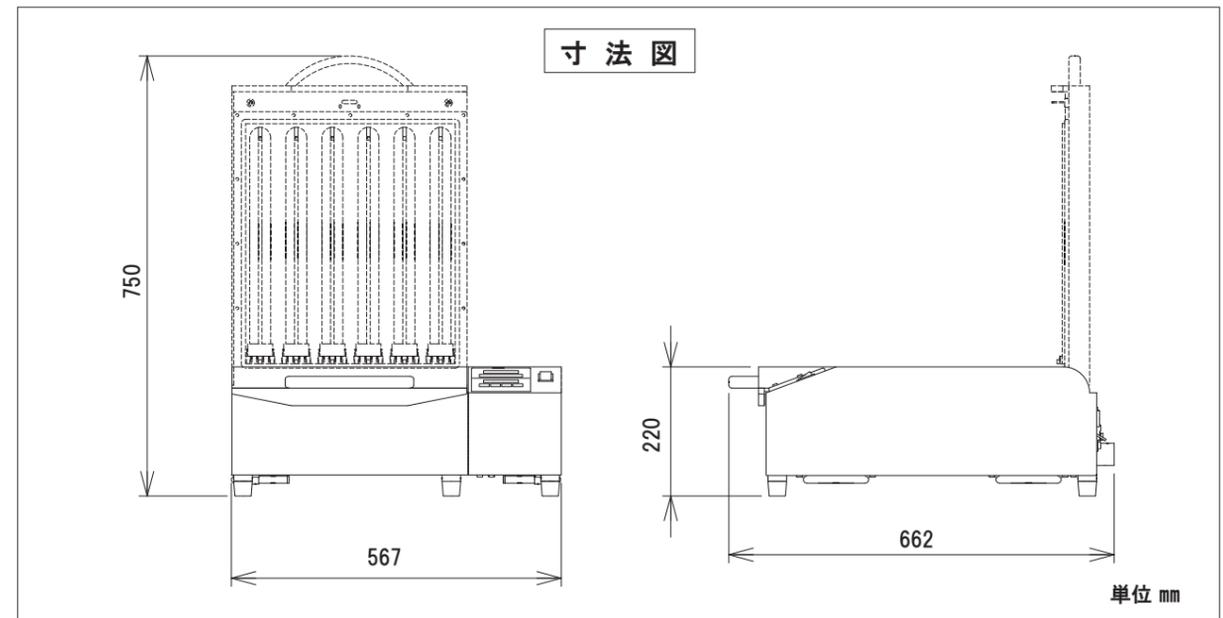
卓上型UV照射装置(オゾン型)

MUV2000



■ MUV2000(オゾン型)仕様

型式	オゾン型 MUV2000
低圧水銀ランプ	オゾンランプ (U字型36W×6本)
波長[nm]	185/254
ランプ安定器	ラピッドスタート式



■ 共通仕様

基板(試料)の大きさ	φ300mm Si ウエハ、ガラス等 □300mm×50mm
基板(試料)ホルダー	□300mm
照射距離	0~50mm 基板(試料)ホルダーの高さ変更で可変
本体大きさ	W567×D662×H220
重量	28[kg]
ワーク取り出し	上蓋開閉式
制御ユニット	①制御方式：PLC制御 ②操作パネル：押しボタンスイッチ方式 ③ランプ電源：本体に内蔵
電源	AC100V 11A(Max時)

■ 用途

- ウエハ、フォトマスク、ガラス基板、光学部品の洗浄
- 樹脂素材の表面改質
- 接着、塗装、印刷、蒸着、はんだ等の密着性の向上
- 表面の濡れ性改善
- 電気製品
- 自動車(外装品・内装品)
- 液晶ディスプレイ
- 半導体
- 光学部品
- 木工用
- その他

当社では、生産設備へのスケールアップ等のご検討も承りますので、ぜひ一度お問い合わせ下さい。